

定制Ptfе实验室清洗篮架 高纯度耐酸碱晶圆支架 低背景无污染化学浴槽架

货号: PL-CP268



简介

探索专为半导体和痕量分析设计的高纯度定制PTFE清洗篮架。这些耐酸碱的支架确保零浸出和超低背景水平，在最苛刻的化学环境中为精密实验室清洗工艺提供可靠的性能。

了解更多

应用领域	描述	主要优势
半导体晶圆清洗	在洁净室环境中进行RCA清洗或HF蚀刻工艺时安全固定硅片。	防止金属污染，确保均匀的化学暴露。
痕量金属分析	清洗用于ICP-OES和ICP-MS样品制备的实验室器皿，以达到ppt级纯度。	消除容器材料本身的背景干扰。
电池研究	在电解质浸泡或化学处理阶段处理阳极和阴极材料。	耐受强有机溶剂和锂盐。
制药灭菌	承载玻璃瓶或精密组件通过高温或化学强效灭菌周期。	保持纯度，防止活性成分的表面吸附。
航空航天部件脱脂	在苛刻化学脱脂剂中进行深度清洗循环时固定精密加工的合金部件。	在工业强度清洗试剂中具有长期耐用性。
太阳能电池制造	在湿法化学处理和织构化阶段支撑光伏基板。	耐高温，与蚀刻剂化学兼容。
地质样品制备	使用浓氢氟酸消解和清洗矿物样品以进行元素测定。	在危险的酸环境中安全操作，且容器不会降解。
规格类别	PL-CP268 参数详情	数值 / 能力
材料特性	主要结构材料	原生高纯度PTFE (聚四氟乙烯)
	痕量元素背景	超低 (适用于PPT级分析)
	化学耐受性	通用 (除熔融碱金属/氟气外)
	吸水率	<0.01%
物理尺寸	配置	可根据客户规格完全定制
	尺寸选项	为2英寸、4英寸、6英寸、8英寸、12英寸晶圆或定制实验室器皿提供量身定制的设计
	操作特性	可选集成手柄、可伸缩臂或锁定盖
温度极限	最高工作温度	260°C (500°F)
	最低工作温度	-200°C (-328°F)
制造详情	制造方法	高精度CNC加工
	表面粗糙度	Ra 0.4 - 0.8 μm (标准) / 可提供抛光选项
	产品编号参考	PL-CP268